

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА $Pb_{1-x}Cd_xSe$
С МАЛЫМ СОДЕРЖАНИЕМ сд ($0 \leq x \leq 0,01$)

М. Х. Максимов, А. П. Шотов

УДК 537.3II.33; 621.375.826

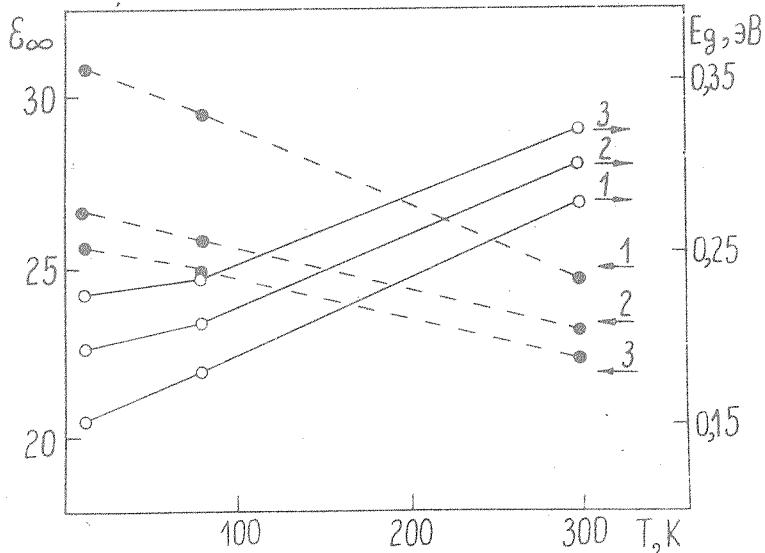
В $Pb_{1-x}Cd_xSe$ при малом содержании сд (до 1%) обнаружено существенное изменение ширины запрещенной зоны, а также электрических и оптических свойств.

При сильном легировании узкощелевых полупроводников типа $A^{IV}B^{VI}$, PbSe, PbTe и твердых растворов на их основе изменяется не только концентрация свободных носителей, но и существенным образом может изменяться энергетический спектр полупроводника, в частности, ширина его запрещенной зоны. Это было обнаружено в $Pb_{0,8}Sn_{0,2}Te$ с примесью Cd по изменениям спектров фотолюминесценции /1/ и фотопроводимости /2/. Детальное знание влияния легирующих примесей на электрические свойства и энергетический спектр необходимо для целенаправленного изменения свойств материалов и создания гетероструктур для оптоэлектронных приборов ИК диапазона, в особенности, перестраиваемых инъекционных лазеров.

В настоящей работе изучались электрические и оптические свойства $Pb_{1-x}Cd_xSe$, содержащего до 1 ат.-% Cd.

I. Изготовление образцов. Эпитаксиальные слои $Pb_{1-x}Cd_xSe$ с малым содержанием сд ($0 \leq x \leq 0,01$) выращивались методом вакуумной молекулярной эпитаксии ("горячей стенки") /3,4/ на свежесколотых подложках (100) KCl или (111) CaF_2 . В качестве исходного материала (источника) при выращивании пленок использовались твердые растворы соответствующего состава, полученные прямым синтезом исходных предварительно очищенных компонентов. Условия выращивания были близки к равновесным,

что позволяло получать эпитаксиальные слои с высокими подвижностями носителей (до $32000 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{с}$ при 77 К для PbSe). В зависимости от условий выращивания пленки получались n- или p-типа с концентрацией носителей $10^{17} - 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Для контроля состава и структуры проводился рентгеноструктурный анализ, который показал, что пленки имеют монокристаллическую структуру. На дифрактограммах не обнаружено линий второй фазы. Слой PbSe давали узкие дифракционные линии. Полужирина линий увеличивалась с ростом содержания Cd. Состав пленок определялся по измерению параметра кристаллической решетки, а также на микронализаторе "Самевах". Было установлено, что постоянная решетки a_0 уменьшается при увеличении содержания Cd, в соответствии



Р и с. I. Зависимость ширины запрещенной зоны E_g и высокочастотной диэлектрической проницаемости ε_∞ от температуры:
 \circ — E_g ; \bullet — ε_∞ ; 1 — PbSe; 2 — $\text{Pb}_{0.995}\text{Cd}_{0.005}\text{Se}$; 3 — $\text{Pb}_{0.99}\text{Cd}_{0.01}\text{Se}$

с данными работы /5/. Нужно отметить, что состав пленок, выращенных на подложках КС1, соответствует в рамках точности измерений составу источника (шихты). Содержание Cd в пленках на BaF_2 было почти в 2 раза больше чем в источнике.

2. Спектр фотопроводимости. Спектральная зависимость фотопроводимости измерялась по обычной схеме с помощью инфракрасного спектрометра ИКС-21 с призмой NaCl на частоте 600 Гц. Фотосигнал с нагрузочного сопротивления подавался на узкополосный усилитель с синхронным детектором. Значение ширины запрещенной зоны определялось по полуамплитуде фотопроводимости. На рис. 1 показано изменение E_g с температурой для $\text{Pb}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Se}$. При введении Cd E_g возрастает от 0,28 эВ ($x = 0$) до 0,30 эВ ($x = 0,005$) и 0,32 эВ ($x = 0,01$) при $T = 300$ К. Температурный коэффициент изменения ширины запрещенной зоны dE_g/dT уменьшается с увеличением концентрации Cd.

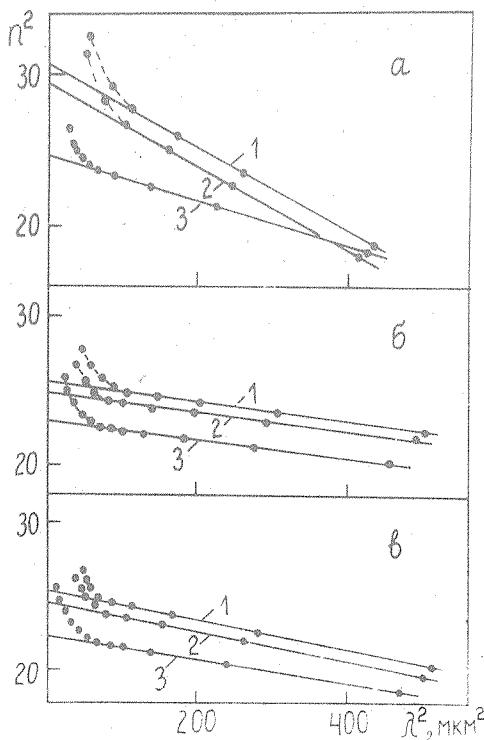
Для выяснения влияния напряжений, возникавших в пленке при низких температурах из-за различия коэффициентов линейного расширения пленки и подложки, на спектры ФП и на величину E_g были сделаны контрольные измерения на свободных слоях без подложки (подложка из КС1 растворялась в воде). Различий в спектрах ФП свободных пленок и на подложках замечено не было.

3. Оптические свойства. Оптическое пропускание пленок измерялось на двухлучевом призменном инфракрасном спектрометре UR-10. Измеряемые образцы с толщиной 2-3 мкм монтировались на хладопроводе в гелиевом криостате с окнами из Квт.

Интерференция света при прохождении сквозь плоскопараллельный слой полупроводника приводит к появлению характерных максимумов в спектре пропускания. Максимумы интерференции имеют место, когда выполняется известное условие $2nd = m\lambda$, где n - показатель преломления, d - толщина пленки, m - целое число. Для расчета показателя преломления толщина пленок d измерялась на электронном сканирующем микроскопе.

На рис. 2 показаны экспериментальные зависимости квадрата показателя преломления от квадрата длины волны. Они линейны в области длинных волн и отклоняются от линейности с приближением к краю собственного поглощения, что связано с быстрым ростом коэффициента поглощения вблизи края фундаментального поглощения /6/. Экстраполацией линейного участка к нулевой длине волн-

ны были найдены значения высокочастотной диэлектрической проницаемости ϵ_{∞} . На рис. I показано изменение ϵ_{∞} с температурой для PbSe и $Pb_{1-x}Cd_xSe$ ($x = 0,005; 0,01$). Для PbSe $\epsilon_{\infty} = 24,5; 29$ и 31,5 при $T = 300, 80$ и 6 К, соответственно, что хорошо согласуется с данными работы /7/. При введении Cd в PbSe ϵ_{∞} уменьшается, край оптического пропускания сдвигает-



Р и с. 2. Зависимость квадрата показателя преломления от квадрата длины волны при 6 К (1), 80 К (2) и 300 К (3),

а - PbSe; б - $Pb_{0,995}^{Cd}0,005Se$; в - $Pb_{0,99}^{Cd}0,01Se$

ся в более коротковолновую область вследствие увеличения ширины запрещенной зоны.

4. Электрические свойства. Измерения эффекта Холла проводились четырехконтактным методом Ван дер Пау в диапазоне температур 4,2–300 К.

Для всех образцов PbSe наблюдался рост коэффициента Холла (R_x) при понижении температур. Величина этого роста менялась от образца к образцу и для отдельных образцов превышала 50%.

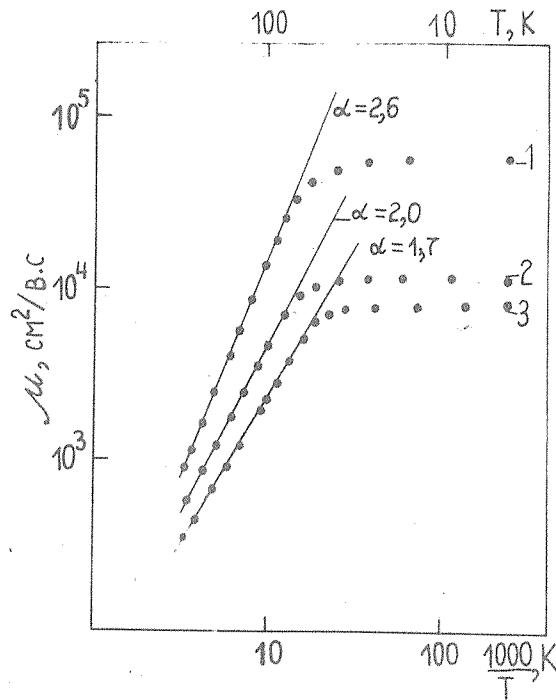


Рис. 3. Зависимость холловской подвижности от температуры:
 1 – PbSe, $n = 4 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$; 2 – $\text{Pb}_{0,995}\text{Cd}_{0,005}\text{Se}$, $n = 2,3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$;
 3 – $\text{Pb}_{0,99}\text{Cd}_{0,01}\text{Se}$, $n = 3,4 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$

Рост R_x становится более заметным для образцов с низкими концентрациями свободных носителей ($1,5 - 2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$).

При введении Cd не наблюдалось существенных изменений в величине R_x и ее температурной зависимости. Колловская концентрация носителей составляла на уровне $2-6 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Только из отдельных образцов $\text{Pb}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Se}$ с $x < 1 \cdot 10^{-3} \text{ см}^{-3}$ при 300 К наблюдался сильный рост R_x при понижении температуры. Слабая зависимость концентрации свободных носителей от содержания Cd в материале показывает, что она в основном определяется соотношением собственных дефектов (вакансий металла и Se) и зависит от условий роста пленок.

На рис. 3 показана температурная зависимость колловской подвижности (μ). При высоких температурах, когда основным является фоновый механизм рассеяния носителей, подвижность меняется по закону $\mu = \mu_0 T^{-\alpha}$. Для PbSe $\alpha = 2,6$. С увеличением концентрации Cd α уменьшается и при $x = 0,01$, $\alpha = 1,7$. Эти изменения можно объяснить температурной зависимостью эффективной массы для сплавов /8/ (при возрастании E_g эффективная масса слабее зависит от температуры). При температурах ниже 40 К подвижность не зависит от температуры. В этой области температур подвижность определяется рассеянием носителей на заряженных центрах (вакансиях и примесях). Наблюдаемое на эксперименте уменьшение абсолютной величины подвижности при низких температурах при $x > 0$ связано с увеличением степени компенсации (числа заряженных центров).

Таким образом, в настоящей работе показано, что в PbSe, при относительно малом содержании Cd (до 1%) наблюдаются существенные изменения ширины запрещенной зоны, а также электрических и оптических свойств.

Поступила в редакцию
12 июля 1982 г.

Л и т е р а т у р а

1. И. И. Засавицкий, Б. Н. Медонинский, А. Н. Шотов, Письма в ЖФ, 32, 156 (1980).
2. M. Lanir, H. Levinstein, Infr. Phys., 18, 259 (1978).
3. A. Lopez-Otero, Thin Solid Films, 42, 1 (1978).

4. К. В. Вяткин, А. Н. Шотов, Б. В. Урсаки, Изв. АН СССР, сер. Неорганические материалы, 17, 24 (1981).
5. F. Wald, A. J. Rosenberg, J. Phys. Chem. Solids, 26, 1087 (1965).
6. F. Stern, Phys. Rev., 133A, 1653 (1964).
7. К. В. Вяткин, А. Н. Шотов, ФТН, 14, I33I (1980).
8. L. H. Rogers, A. J. Crocker, J. Phys. D, 4, 1006 (1971).